

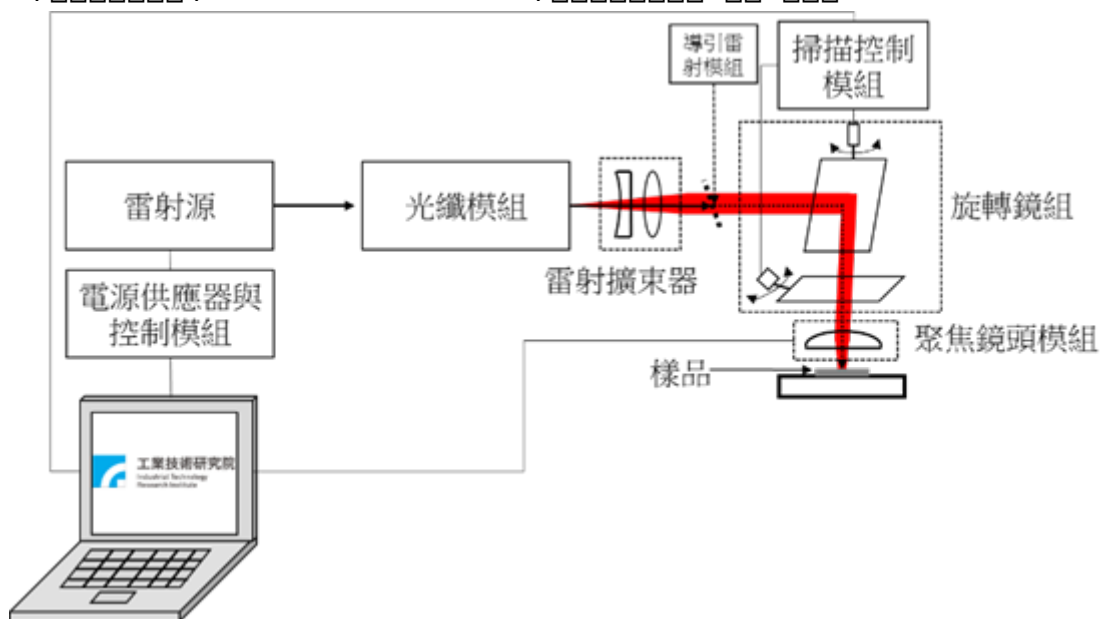
3. Nd:YVO₄
 75kHz
 2.5W
 1064nm
 38um
 0.1ms
 10ns
 20um
 45~190mm/s

▪ 實驗步驟

1. 將304不銹鋼樣品切割成75%的厚度
2. 使用AutoCAD繪製樣品圖
3. 將樣品切割成所需尺寸
4. 將304不銹鋼樣品切割成所需尺寸
5. 切割完成

▪ 實驗原理

雷射系統由雷射源 (Radiation source)、電源供應器與控制模組 (Power & control module)、光纖模組 (optical fiber)、雷射擴束器 (Beam expander)、導引雷射模組 (Guide laser module)、掃描控制模組 (Scanner control unit)、旋轉鏡組 (Rotating mirrors)、聚焦鏡頭模組 (Focus lens module) 等組成一體。



1. 雷射系統

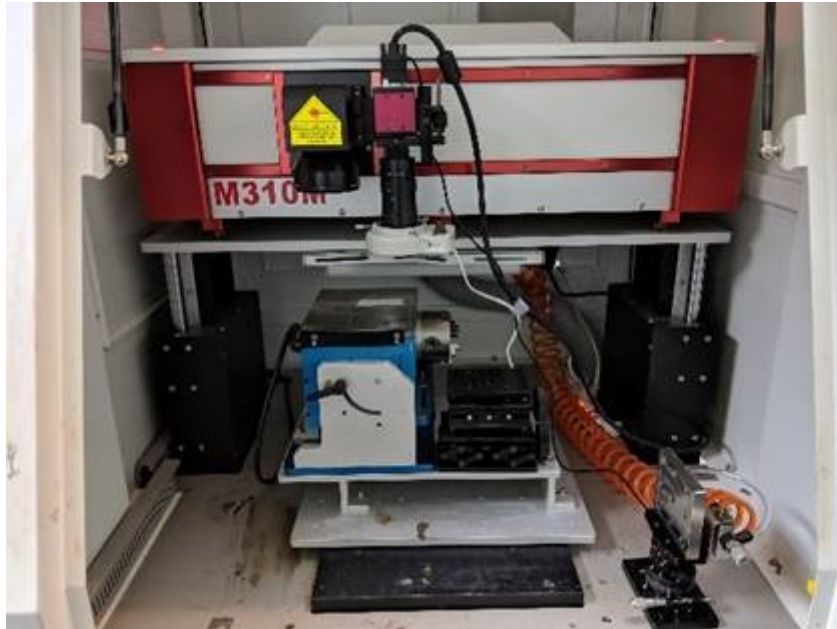


圖 2 磁控濺鍍系統

- 磁控濺鍍系統
- 磁控濺鍍

磁控濺鍍系統通常使用 304 不銹鋼作為靶材，其成分中約含有 10-15% 的鉻 (Cr₂O₃)。在濺鍍過程中，鉻離子會沉積在基板上，形成一層薄層。這層薄層的厚度通常在 3 納米左右。由於鉻離子的沉積速率較慢，因此需要較長的濺鍍時間。此外，磁控濺鍍系統還可以沉積其他金屬氧化物，如 Cr₂O₃。根據 [1] 的資料，Cr₂O₃ 薄膜的厚度可以達到 1-4 納米。這表明磁控濺鍍系統可以沉積出超薄且均勻的 Cr₂O₃ 薄膜。

磁控濺鍍系統通常使用 C-1 靶材，其成分中約含有 10-15% 的鉻 (Cr₂O₃)。在濺鍍過程中，鉻離子會沉積在基板上，形成一層薄層。這層薄層的厚度通常在 3 納米左右。由於鉻離子的沉積速率較慢，因此需要較長的濺鍍時間。此外，磁控濺鍍系統還可以沉積其他金屬氧化物，如 Cr₂O₃。根據 [1-4] 的資料，Cr₂O₃ 薄膜的厚度可以達到 1-4 納米。這表明磁控濺鍍系統可以沉積出超薄且均勻的 Cr₂O₃ 薄膜。

圖3(A)



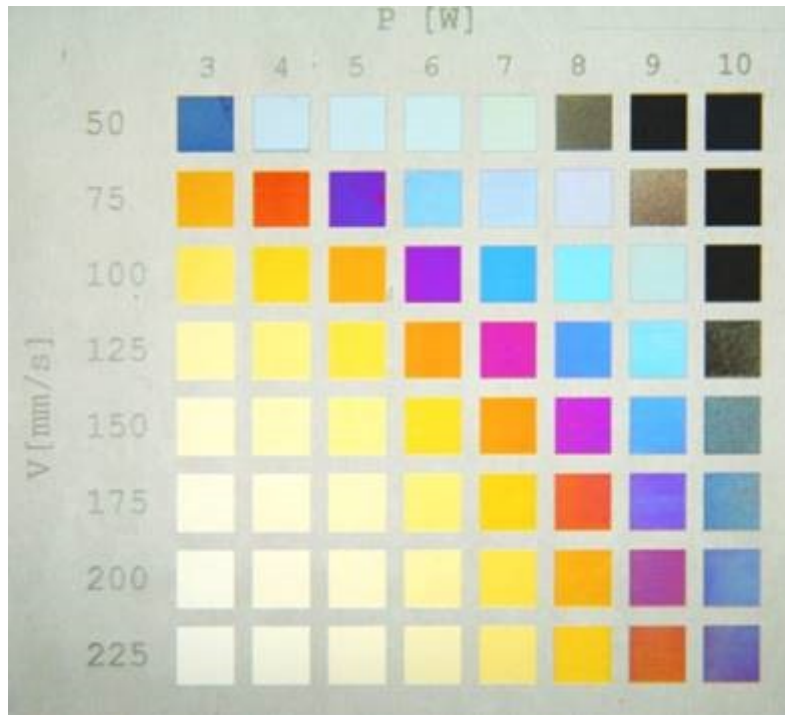
圖3(B)

A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
145 mm/s	150 mm/s	155 mm/s	160 mm/s	165 mm/s	170 mm/s	175 mm/s	180 mm/s	185 mm/s	190 mm/s
B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9	B-10
95 mm/s	100 mm/s	105 mm/s	110 mm/s	115 mm/s	120 mm/s	125 mm/s	130 mm/s	135 mm/s	140 mm/s
C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10
45 mm/s	50 mm/s	55 mm/s	60 mm/s	65 mm/s	70 mm/s	75 mm/s	80 mm/s	85 mm/s	90 mm/s

3 (A) (mm/s)

-

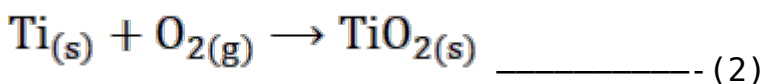
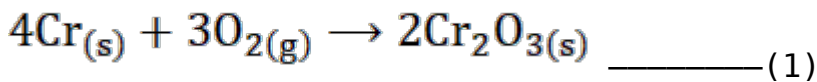
4 Ti TiO₂ TiO₂ TiO₂ [5]



4[5]

(Antończak, A. J. et.al, (2014). The influence of process parameters on the laser-induced coloring of titanium. *Applied Physics A*, 115(3), 1003-1013.)

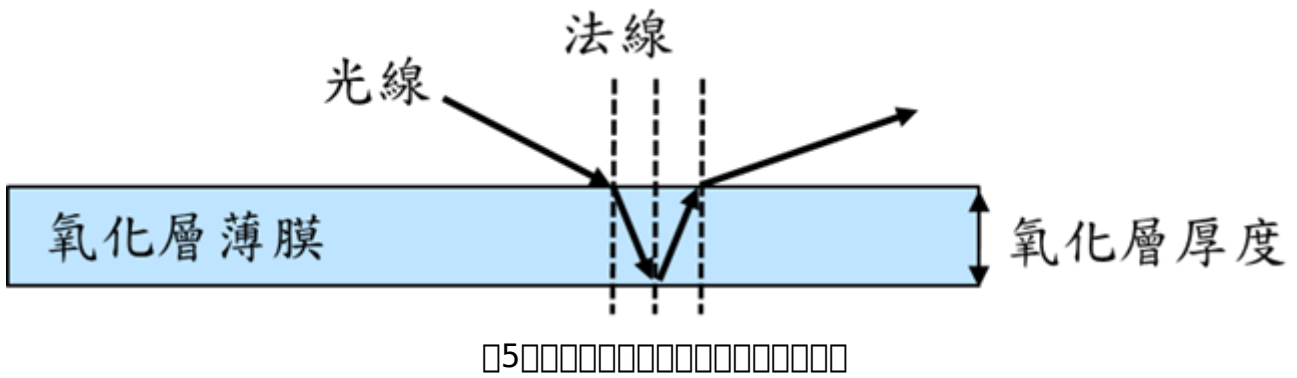
-



-

1621 (Willebrord Snellius) (Snell's Law) (Refractive index) (Refraction) 1666 (Isaac Newton) (Dispersion)

(Activation Energy) (Cr₂O₃) (TiO₂) (5)



- 干涉
- 1. 光程差
- 2. 光程差

https://drive.google.com/open?id=1eeJW9h_8W0Ywye5anKR1YjXI71a6QmyG

- 干涉
- 干涉 (Ex: 干涉) 干涉 (Ex: 干涉) 干涉 (Ex: 干涉) 干涉 (Ex: TiO_2 Cr_2O_3) 干涉 (Ex: SiO_2) 干涉 (Thin-film) 干涉

- 干涉
- 干涉 干涉

- 干涉
1. Lehmuskero, A., Kontturi, V., Hiltunen, J., & Kuittinen, M. (2010). Modeling of laser-colored stainless steel surfaces by color pixels. *Applied Physics B*, 98(2-3), 497-500.
 2. Veiko, V., Odintsova, G., Ageev, E., Karlagina, Y., Loginov, A., Skuratova, A., & Gorbunova, E. (2014). Controlled oxide films formation by nanosecond laser pulses for color marking. *Optics express*, 22(20), 24342-24347.
 3. Fujimoto, S., Tsujino, K., & Shibata, T. (2001). Growth and

properties of Cr-rich thick and porous oxide films on Type 304 stainless steel formed by square wave potential pulse polarisation. *Electrochimica Acta*, 47(4), 543-551.

4. Antończak, A. J., Kocoń, D., Nowak, M., Kozioł, P., & Abramski, K. M. (2013). Laser-induced colour marking–Sensitivity scaling for a stainless steel. *Applied Surface Science*, 264, 229-236.
5. Antończak, A. J., Stępak, B., Kozioł, P. E., & Abramski, K. M. (2014). The influence of process parameters on the laser-induced coloring of titanium. *Applied Physics A*, 115(3), 1003-1013.